



一种光学基片镀膜前的清洗方法

文献类型：专利

作者 龚选香；李刚；孙龙

发表日期 2014

专利国别 CN

专利号 CN201210387481.7

专利类型 发明

权利人 中国科学院大连化学物理研究所

是否PCT专利 否

中文摘要 本发明涉及一种光学基片镀膜前的清洗方法。该操作方法采用正庚烷代替乙醚和乙醇按一定比例配成混合清洗液，滴在光学清洗无尘布上对光学石英玻璃进行擦拭清洗。在高亮度光学检测灯的照射下，观察基片的去污情况，从而达到基片清洁的目的。用此方法清洗镀膜前的光学基片可以提高光学薄膜的附着力和增强薄膜的抗激光损伤阈值，提高光学薄膜的使用寿命。

公开日期 2014-04-16

申请日期 2012-10-12

语种 中文

专利申请号 CN201210387481.7

源URL [http://159.226.238.44/handle/321008/120593]

专题 大连化学物理研究所_中国科学院大连化学物理研究所

推荐引用方式 龚选香,李刚,孙龙. 一种光学基片镀膜前的清洗方法, 一种光学基片镀膜前的清洗方法, CN201210387481.7. 2014-GB/T 7714 01-01.

入库方式：OAI收割

来源：大连化学物理研究所

| | | |
|-----------|---------|---------|
| 浏览 225 | 下载 0 | 收藏 0 |
|-----------|---------|---------|

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。